ХИМИЧЕСКОЕ ГАЗОФАЗНОЕ ОСАЖДЕНИЕ Аg-СОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ: ЭФФЕКТ VUV-АКТИВАЦИИ

Викулова Е.С. (1), Гуляев С.А. (1,2), Шутилов Р.А. (1)
(1) Институт неорганической химии СО РАН
630090, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, д. 3
(2) Новосибирский государственный университет
630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 2

Серебросодержащие материалы традиционно используют в качестве антибактериального агента в различных медицинских изделиях, в том числе для покрытия медицинских имплантатов. Комбинация Ag с другими благородными металлами, например Au, Pt, Ir, обеспечивает анодное растворение серебра, что существенно усиливает биологическое действие. Такие улучшенные материалы востребованы для иммунодепрессных групп больных, в частности, онкологических.

Удобную платформу для получения предлагаемых гетерометаллических систем на объектах сложной формы, к которым относятся имплантаты, представляет химическое газофазное осаждение (MOCVD). Основные исследования в области MOCVD Ад-содержащих материалов направлены на разработку эффективных прекурсоров или способов вапоризации. Значительно меньшее внимание уделено дополнительной стимуляции процессов осаждения. Наряду с классическим термическим MOCVD с использованием специальных газов-реагентов, превалирует плазма-активированное осаждение.

В данной работе впервые протестирован эффект активации вакуумным ультрафиолетом (VUV-MOCVD). МОСVD эксперименты проводили в следующих условиях: T(испарителя) = 120 °C, T(осаждения) = 200–240 °C, T(осаждения) = 200–240 °C, T(осаждения) = 200–240 °C, T(осаждения) = 9 л/ч, T(осаждения) = 200–240 °C, T(осаждения) = 200–240 °C, T(осаждения) = 200–240 °C, T(осаждения) = 9 л/ч, T(осаждения) = 200–240 °C, T(осаждения) = 9 л/ч, T(осаждения) = 200–240 °C, T(осаждения) = 200–240 °C,

Показано, что облучение активирует процесс осаждения: например, на Si при 240 °C, v(Ar) = 9 л/ч и $v(H_2) = 12$ л/ч без VUV получены наночастицы, с VUV – сплошная пленка. На слое Ir, при более низких $v(H_2)$, осаждение серебра происходит только в облучаемой зоне. Это открывает новые возможности для формирования характера распределения антибактериального компонента по поверхности имплантата.

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Р Φ для молодых ученых-кандидатов наук МК-6148.2021.1.3.